

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 12 月 7 日 (2006.12.7)

【公開番号】特開 2005-132751 (P2005-132751A)

【公開日】平成 17 年 5 月 26 日 (2005.5.26)

【年通号数】公開・登録公報 2005-020

【出願番号】特願 2003-368529 (P2003-368529)

【国際特許分類】

**C 0 7 F 7/08 (2006.01)**

【 F I 】

C 0 7 F 7/08 X

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 10 月 20 日 (2006.10.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 5

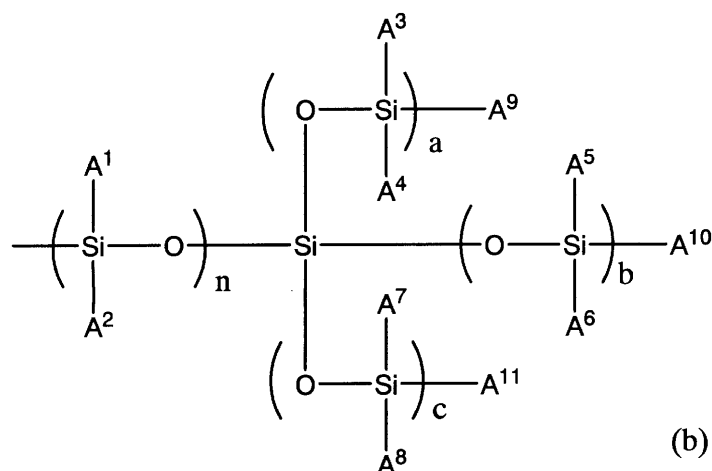
【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 5】

一般式 (z) または (z') において、シロキサニル基 (A) が下記式 (b) で表される置換基である請求項 3 または 4 記載のシリコン化合物の製造方法。

【化 1】



[ 式 (b) 中、 $A^1 \sim A^{11}$  はそれぞれが互いに独立に水素、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基のいずれかを表す。n は 0 ~ 200 の整数を表し、a、b、c はそれぞれが互いに独立に 0 ~ 20 の整数を表す。ただし  $n = a = b = c = 0$  の場合は除く。]

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

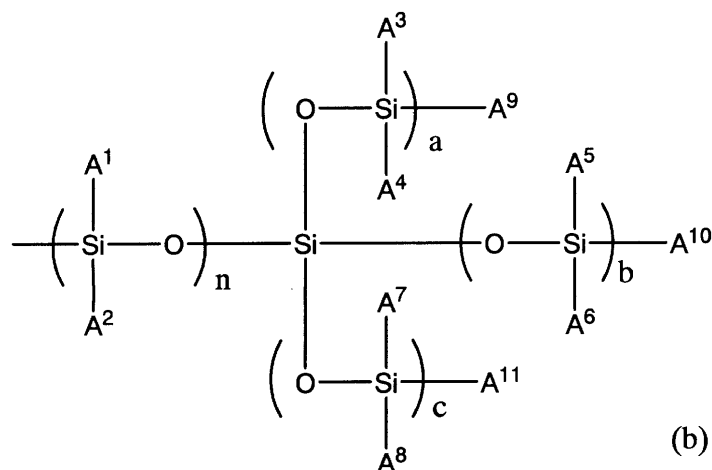
【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0031】

## 【化 2】



〔式 (b) 中、 $A^1 \sim A^{11}$  はそれぞれが互いに独立に水素、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基のいずれかを表す。 $n$  は 0 ~ 200 の整数を表し、 $a$ 、 $b$ 、 $c$  はそれぞれが互いに独立に 0 ~ 20 の整数を表す。ただし  $n = a = b = c = 0$  の場合は除く。〕

(6) 一般式 (z) または (z') において、シロキサニル基 (A) がトリス (トリメチルシロキシ) シリル基、ビス (トリメチルシロキシ) メチルシリル基、トリメチルシロキシジメチルシリル基から選ばれた置換基であることを特徴とする前記 (3) または (4) 記載のシリコン化合物の製造方法。」

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

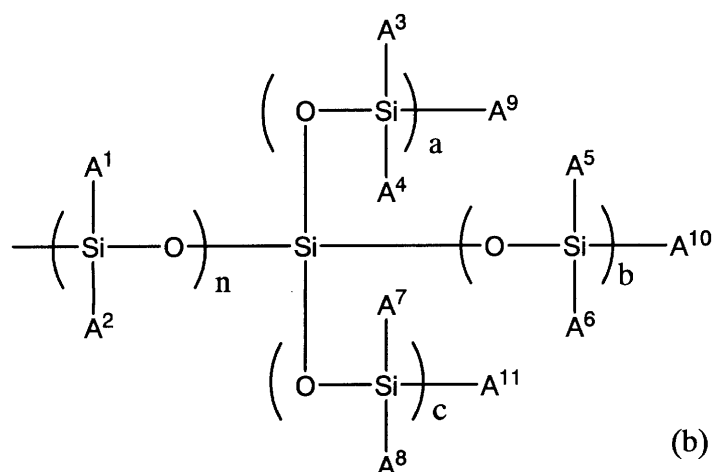
【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0036】

## 【化 3】



〔式 (b) 中、 $A^1 \sim A^{11}$  はそれぞれが互いに独立に水素、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基のいずれかを表す。 $n$  は 0 ~ 200 の整数を表し、 $a$ 、 $b$ 、 $c$  はそれぞれが互いに独立に 0 ~ 20 の整数を表す。ただし  $n = a = b = c = 0$  の場合は除く。〕

式 (b) 中、 $A^1$  から  $A^{11}$  はそれぞれが独立に水素、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基などのアルキル基、フェニル基、ナフチル基などのアリール基などを挙げることができる。これらの中で最も好まし

いのはメチル基である。